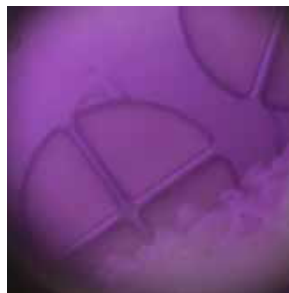


RotoVAC 旋转真空等离子处理设备

产品特征:

- 安装简单，使用简便
- 处理时间短
- 标准或定制化的处理腔体
- 真空度
- 无需工艺气体
- 控制处理过程
- 节约成本
- 真空下的等离子处理



标准和定制化的真空等离子处理设备

Tantec的RotoVAC等离子处理设备用于处理小型注塑部件，无需放在支架上或使用复杂的搬运机构。RotoTEC采用旋转的圆桶式设计，将处理产品放在圆桶中，再将圆桶放入真空腔体中旋转便可以均匀的处理到产品所有表面。

在等离子电极放电前，处理仓里会出现一个0.1至4mbar的真空，因此处理的时间非常短，根据产品的材质和结构，一般在20-180s之间。

RotoVAC等离子处理设备具有操作简单、生产可靠性高、处理速度快等特点。可使用氩气或氧气等工艺气体，但是大多数情况下，等离子放电产生的高能量就可以大大提高物体表面能量，因此无需再使用这些工艺气体。

RotoVAC采用先进的HV-X系列的放电发生器，等离子变压器根据电极进行设计，并为其提供高压。圆桶的旋转可保证每个产品得到处理。可另多配一个圆桶，以便轮流使用。

Head Office

Tantec A/S
Industrivej 6
DK-6640 Lunderskov
(+45) 7558 5822

Mail:
sales@tantec.com

Web:
www.tantec.com
www.china-tantec.com (中文)

中国区总代:
昆山市坦钛等离子科技有限公司

Tel:
0512-50333890

Mobile:
13862667395

Mail:
sales@china-tantec.com

特点:

- 安装简单，使用简便
连接电源和压缩的空气即可。
- 处理时间短
根据产品材质和结构，一般在20-180s内即可完成。
- 标准或定制化的处理仓
处理仓和圆桶的大小可根据实际应用进行设计，一般情况下是标准的处理仓。
- 真空度
根据实际应用，真空度一般在1-4mbar。
- 无需工艺气体
可使用氧气和氩气等工艺气体，但大多数情况下无需使用这些工艺气体。
- 控制处理过程
等离子整个过程是由HV-X系列放电发生器和PLC装置进行控制。触摸面板上显示了所有控制参数（标准——proface）
- 节约成本
由于能耗低，不需特殊的工艺气体，该套设备大大节约了成本，是改善物体表面润湿性和粘合性的最佳方法。
- 真空下的等离子处理
可处理导电和非导电的物体表面。

技术规格	RotoVAC旋转真空等离子处理设备
电源电压及频率	230 VAC or 480 VAC 3Ph.
输出电压/等离子功率	Max. 400 Vp/max. 2000 Watt
电源供应	HV-X系列等离子放电发生器
压缩空气进气口	5-6 bar, 干燥清洁
工艺气体	标准：空气；如有要求，可使用氧气、氩气、氮气等
真空泵容量，单位：立方米/分	15-240立方米/分；根据真空仓的大小
真空度	1-4 mbar
标准排气时间	20-120s, 根据真空仓的大小和泵容量
标准等离子处理时间	在20-180s之间（根据产品结构和材质而定）
控制和连接	含触摸屏（标准—Proface）
遵循法规	CE - RoHs - WEEE